# 合体によるシリンダー構造への転移が可能な非平衡な球状ドメインを 用いたシリンダー構造の配向制御 — 延伸固定状態での熱処理

Orientation Control of Cylindrical Microdomains by Using Non-equilibrium Spheres Which Have Ability to Transform into Cylinder via Coalescence – Thermal Annealing of a Film Under a Stretched State

## 富田翔伍<sup>1</sup>,五十嵐教之<sup>2</sup>,清水伸隆<sup>2</sup>,佐々木園<sup>1</sup>,櫻井伸一<sup>1,\*</sup>

### 1京都工芸繊維大学,〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎御所海道町

<sup>2</sup>放射光科学研究施設,〒305-0801 つくば市大穂 1-1

Shogo Tomita<sup>1</sup>, Noriyuki Igarashi<sup>2</sup>, Nobutaka Shimizu<sup>2</sup>, Sono Sasaki<sup>1</sup>, and Shinichi Sakurai<sup>1,\*</sup> <sup>1</sup>Department of Biobased Materials Science, Graduate School of Science and Technology, Kyoto Institute of Technology, Matsugasaki, Sakyo-ku, Kyoto 606-8585, Japan <sup>2</sup>Photon Factory, 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan

#### 1 <u>はじめに</u>

ゴム状の高分子鎖が、微結晶やガラス状のミクロ ドメインを物理的架橋点としてネットワークを形成 した材料を、熱可塑性エラストマーと呼ぶ。非晶性 ブロック共重合体の場合、ガラス状態にある球状ミ クロ相分離構造が物理的架橋点の役目を担う。我々 はこれまでに、シリンダーに転移する能力を持つ非 平衡な球状ドメインから成る熱可塑性エラストマー フィルムを圧縮することによって、配向シリンダー が形成される過程について調べてきた。今回は、一 軸延伸下における非平衡な球状ドメインの熱処理に ともなう構造変化を明らかにするために、フィルム が破断しないよう延伸状態を保持したまま 2 次元小 角 X 線散乱(2d-SAXS)測定を行った。

#### 2 <u>実験</u>

用いた試料は、スチレン-エチレンブチレン-スチ レントリブロック共重合体(SEBS16)である。そのキ ャラクタリゼーションは数平均分子量(Mn)が 6.6× 10<sup>4</sup>、分子量分布の多分散指数(Mw/Mn)が 1.03、ポリ スチレン(PS)の体積分率(Φ<sub>PS</sub>)が 0.16 である。また、 秩序-無秩序転移温度 T<sub>ODT</sub> は 247℃である。この試 料を PS に選択的に貧溶媒である n-ヘプタンを用い て溶液キャストすると非平衡な球状ミクロ相分離が 形成された。実際には、この試料を塩化メチレンと n-ヘプタンの混合溶媒に溶解し、5wt%の SEBS 溶液 を作製した。その後、キャスト法によって、膜厚 0.3 mm の as-cast film を作製した。得られた as-cast film を 3.5 mm × 16 mm のサイズに切り取り、4 枚 重ねて厚みを 1.2 mm にした。その後フィルムの両 端を 5 mm ずつ掴み、初期長を 6 mm として、18 mm まで 3 倍延伸した。その後、延伸したフィルム を 2 枚のカバーガラス (0.12mm 厚) ではさんでネ ジで固定し、チャックからフィルムを解放した。こ の時、フィルムは縮むことはなかった。このように して作製した、カバーガラスで延伸状態を固定した フィルムを、あらかじめ 170℃に熱しておいたヒー ターブロック内に入れ、カバーガラスと平行な方向 から X 線を試料に入射し、2d-SAXS パターン (edge 像)の時間変化を追跡した。なお、後述するが、実 際の試料の温度を計測したところ、測定開始後 3 分 で 132℃に到達し、その後の温度の変化はなく一定 であった (ヒータブロックの設定温度 170℃にはな らなかった)。

#### 3 結果および考察

図1 に延伸固定状態で熱処理を行ったときの、時 分割 2d-SAXS 測定結果の時間変化を示す。図中の qは散乱ベクトルの大きさであり  $q = (4\pi/\lambda)\sin(\theta/2)$ で表される。ここで  $\lambda$  は X 線の波長、 $\theta$  は散乱角 である。この図に表示されている時間は、熱処理を 開始した時点からの経過時間であり、実際の試料の 温度は図2中に示すように変化している。図 1(a)は 熱処理前の結果で、(b)-(d)はそれぞれ熱処理を開始 してから、40、80、280 秒後の結果である。(a)のパ ターンは球状ミクロ相分離構造を延伸したときに見 られる典型的なパターンであり、延伸方向に平行な q ベクトル方向では BCC 格子の面間隔が広がり、垂 直な方向では狭くなることに起因している。これを 熱処理すると、まず図1(b)のように延伸方向に平行 な方向のピーク強度が激減し、4 点ストリークパタ ーンへと変化した。この4点ストリークは時間が経 過しても残存し、図1(d)の280秒後でも見られる。 図2は4点ストリークのピーク位置から計算した面 間隔とピークが出現している方位角の時間変化であ る。方位角 μ は図 1 (a) 中に示したように定義した。 図1(a)のひずんだ SAXS パターンの1次ピークの強 度を精査すると、方位角 60.4°の位置でピーク強度 が強いことがわかった。また、その方位角における ピーク位置(q\*の値)から{110}面の面間隔 d(=  $2\pi/q^*$ )を計算したところ、d = 32.0 nmが得られた。 このことから、熱処理前の延伸状態にある試料中に 形成されている BCC 格子は、図3(a)に示したよう な状態にひずんでいると推定される。なお、この図 は、(1-10)面上の球状ミクロドメインの配列を示し たもので、赤い実線は(110)面であり、延伸方向は水 平方向である。また、この図は、未延伸状態の BCC 格子のうち、特定方位に配向している BCC 格子を affine 変形させて得られたものである。

これに対して、図1(c)に示したように 80 秒後に は、1次ピークのひずみは解消されているが、4点 の強い1次ピークは依然としてスポット状に残存し ている。これが出現している方位角は 65.0°で、面 間隔は d = 26.0nm であった。この面間隔の値は、延 伸前の as-cast 試料中に形成されている BCC 格子の {110}面間隔にほぼ等しい。つまり、80 秒の熱処理 によって、ほぼ完全に格子のひずみは解消したと言 うことができる。この結果に基づき、描いた BCC 格子の状態を図3(b)に示した。格子の配向方向は、 依然として残存している4点スポットの出現してい る方位角(65.0°)と一致させてある。熱処理によ って、図3(a)から(b)への変化が主に起こったものと 結論することができる。もちろん、ブロードな等方 的なリング状の1次ピークが観察されていることか ら、BCC 格子の配向はほぼランダムであるという特 徴は有していることを忘れてはならない。ただ、図 3(a)から(b)への変化が 80 秒程度の短時間に起こり 得るのかどうかを吟味するため、格子の模式図を重 ねて図示したものを図3(c)に示した。この図で、白 丸は図3 (a)で示した球の配置を、黒丸は図3(b)で 示した球の配置を示している。また、図中の上向き の真っすぐな矢印で示した位置では、白丸と黒丸が 重なっている。熱処理によって面間隔が 20%程度減 少する理由は、緊張状態にあったソフト鎖が緩和す ることによって、白丸から黒丸への球の移動が起こ るためだと説明できる。このような球の移動は熱処 理による分子鎖の引き抜きと再凝集によって局所的 には容易に起こり得るものである(図中の矢印で示 した位置での球の配置の変化を一切ともなう必要が ない)。換言すれば、弾性限界内での一軸延伸→延 伸を緩める、という一連の操作で、ひずんだ BCC 格子がほぼ現状復帰する過程とは大きく異なってい るのである。実際、試料の巨視的なサイズは熱処理 後も変化していなかった。ただし、試料の中央部に 空隙が発生したり端面に無数の亀裂が発生していた。

最後に、本実験で行ったような手の込んだ手法に よって、残念ながら当初の目的であった配向シリン ダーの達成には至らなかった(680 秒よりも長時間 熱処理を続けると、シリンダーに転移するものと推 察されるが、その配向性は期待できない)ものの、 BCC 格子の配向(方位角 65.0°への優先配向)がも たらされたという興味深い現象が見られた。



図2:4 点ストリークのピーク位置から計算した面 間隔 d とピークが出現している方位角の時間変化



図3:(a) 延伸状態にある試料中に形成されている ひずんだBCC格子。(b) 熱処理によってひずみが解 消した後のBCC格子の配向状態。(c) 模式図(a)で示 した格子上に模式図(b)で示した格子を重ねた状態。

\* shin@kit.ac.jp